

Úloha IV.S ... svítíme

10 bodů; průměr 8,67; řešili 3 studenti

1. V jaké vzdálenosti od povrchu terče (předpokládejte, že je z uhlíku a pro laser o vlnové délce 351 nm) se nachází kritický povrch a v jaké vzdálenosti dochází ke vzniku dvou-plazmonového rozpadu, pokud je charakteristická délka plazmatu¹ 50 μm? Dále předpokládejte
 - (a) exponenciální pokles hustoty plazmatu s rostoucí vzdáleností od terče,
 - (b) lineární pokles hustoty plazmatu s rostoucí vzdáleností od terče.
2. Jakou musí mít elektrony energii, aby prošly od kritického povrchu ke skutečnému povrchu terče? Pro dosah elektronů v uhlíkovém plazmatu využijte empirický vztah $R = 0,9334E^{1,7567}$, kde E je v MeV a R je v $\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$.
3. Na jaké délce se elektrony v elektrickém poli plazmové vlny urychlí na tyto energie?
4. Jaké vlnové délky rozptýleného světla můžeme pozorovat v případě stimulovaného Ramanova rozptylu pro laser o vlnové délce 351 nm?

Označme n_{e0} elektrónovú hustotu pre uhlíkovú plazmu. V našom prípade predpokladáme, že úplne vyionizujeme uhlík, teda na jedno jadro uhlíka bude pripadať 6 elektrónov. Hustotu atómov spočítame ako $N = \rho_C/m_C$, pričom ρ_C je hustota uhlíka, a m_C je hmotnosť jedného atómu uhlíka. Po dosadení dostávame $n_{e0} = 6\rho_C/m_C = 6,8 \cdot 10^{23} \text{ cm}^{-3}$. Dosadíme do vzťahu z textu seriálu

$$n_c = \frac{m\varepsilon_0\omega_0^2}{e^2},$$

$$n_c = \frac{0,5 \text{ MeV}}{c^2} 55 e^2 \text{ GeV}^{-1} \text{ fm}^{-1} \left(\frac{2\pi c}{\lambda}\right)^2 = 8,8 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3}.$$

Lineárny pokles vyjadríme vzťahom

$$n_c = n_{e0} \left(1 - \frac{x}{x_c}\right),$$

kde x_c je charakteristická dĺžka v plazme. Pre polomer kritického povrchu máme

$$x = x_c \left(1 - \frac{n_c}{n_{e0}}\right) = 49,4 \mu\text{m}.$$

Obdobne exponenciálny pokles

$$n_c = n_{e0} e^{-\frac{x}{x_c}},$$

konkrétne

$$x = x_c \ln\left(\frac{n_{e0}}{n_c}\right) = 220 \mu\text{m}.$$

Pre dvojplazmonový rozpad platia rovnaké vzťahy, pričom len položíme n_c rovné štvrtine oproti prvej časti. Pre lineárny pokles dostávame $x = 49,8 \mu\text{m}$ a pre exponenciálny $x = 290 \mu\text{m}$. Pri porovnaní hodnôt a po konzultácii s náčrtkom v texte seriálu je zjavné, že exponenciálny popis je v tomto prípade nutný/správny.

¹Hustota plazmatu n_e v závislosti na vzdálenosti od terče se typicky vyjadruje jako funkce $n_e = f\left(\frac{x}{x_c}\right)$, kde x je vzdálenost od terče a x_c je tzv. charakteristická délka plazmatu, která představuje škálovací parametr od terče.

Pokračujme v řešení druhej podúlohy. Veličina R je definovaná pomocou hustoty plazmy a spočítame ju ako

$$R = \int_0^x \rho \, dl.$$

Ak predpokladáme, že hustota ρ je závislá na l rovnako ako n_e , tak môžeme napísať

$$R = \int_0^x \rho_0 e^{-\frac{l}{x_c}} \, dl.$$

Keďže $x \gg x_c$, môžeme zmeniť integračné medze na

$$\begin{aligned} R &= \int_0^\infty \rho_0 e^{-\frac{l}{x_c}} \, dl, \\ R &= \left[-x_c \rho_0 e^{-\frac{l}{x_c}} \right]_0^\infty, \\ R &= x_c \rho_0. \end{aligned}$$

Pre zasiahnutie terča potrebujeme elektróny aspoň s takýmto dosahom. Ďalej vyjadríme E z empirického vzťahu zo zadania a dosadíme

$$\begin{aligned} E &= \left(\frac{R}{0,9334} \right)^{1/1,7567}, \\ E &= \left(\frac{x_c \rho_0}{0,9334} \right)^{1/1,7567}, \\ E &\doteq 80 \text{ keV}. \end{aligned}$$

Elektróny musia mať energiu aspoň 80 keV, aby zasiahli povrch terča.

K urýchleniu elektrónov na túto energiu pomocou plazmových vln využijeme vzťah z textu seriálu pre intenzitu elektrického poľa

$$E = \frac{mc\omega_{pe}}{e},$$

kde plazmovú frekvenciu vypočítame ako

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{e^2 n_e}{m\varepsilon_0}}.$$

Nás zaujíma hlavne urýchlenie na vysoké energie v oblasti kritického povrchu, teda $n_e = n_c$, čo po dosadení dáva

$$\begin{aligned} \omega_{pe} &= \sqrt{\frac{e^2 \frac{m\varepsilon_0 \omega_0^2}{e^2}}{m\varepsilon_0}}, \\ \omega_{pe} &= \omega_0. \end{aligned}$$

Dráhu, na kterou sa elektron urýchli spočítame ako $l = \frac{U}{E}$, kde $U = 80 \text{ kV}$ pretože elektron má náboj $1e$. Po dosadení

$$l = \frac{U}{\frac{mc\omega_0}{e}},$$

$$l = \frac{80 \text{ kV}}{\frac{500 \text{ keV}}{c^2} c \frac{2\pi c}{\lambda}},$$

$$l \doteq 9 \text{ nm}.$$

Vieme, že k stimulovanému Ramanovmu rozptylu dochádza pri $n_e < \frac{n_c}{4}$. Zo zákona zachovania energie platí $\omega_0 = \omega_1 + \omega_2$, kde v našom prípade je $\omega_1 = \omega_{pe}$ pre $n_e < \frac{n_c}{4}$, a $\omega_2 = \frac{2\pi c}{\lambda_R}$, kde λ_R je vlnová dĺžka, ktorú Ramanov rozptyl môže dosiahnuť.

Po dosadení $n_e = \frac{n_c}{4}$ do vzťahu

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{e^2 n_e}{m\varepsilon_0}},$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{e^2 \frac{n_c}{4}}{m\varepsilon_0}},$$

$$\omega_{pe} = \frac{\omega_0}{2}.$$

Vidíme, že polovica energie ide do plazmy, z toho logicky druhá polovica do Ramanovho rozptylu. Odtiaľto vyplýva, že frekvencia bude polovičná ako je frekvencia laseru, teda vlnová dĺžka je dvojnásobná $\lambda_R = 702 \text{ nm}$. Stimulovaný Ramanov rozptyl môžeme pozorovať na vlnových dĺžkach 702 nm až 351 nm .

Michal Červeňák
miso@fykos.cz

Fyzikální korespondenční seminář je organizován studenty MFF UK. Je zastřešen Oddělením propagace a mediální komunikace MFF UK a podporován Ústavem teoretické fyziky MFF UK, jeho zaměstnanci a Jednotou českých matematiků a fyziků.

Toto dílo je šířeno pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Pro zobrazení kopie této licence navštivte <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>.